

6. 発明の「解像度」(★)



特許発明は文章で記載する～「技術理解力」+「文章力」
～発明者から聴いた具体例だけを特許化することに付加価値はない。
他方、過度に広げてしまうと、発明の解像度が低くなり、記載要件×。

研究者が意識した発明(具体例)を、
「進める(=それで)」「深める(=なぜ)」「戻す(=本当に?)」という思考を行う。

明細書に記載する発明の解像度を高め、
特許出願価値を最大化する。

「自分の常識は、先入観であると心得る」
「違う人の視点から考える」(122頁、127頁)



「言葉にできるは武器になる」(梅田悟司・著)(66頁)

「解像度を上げる-曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法」(馬田隆明・著、2022年、英知出版)

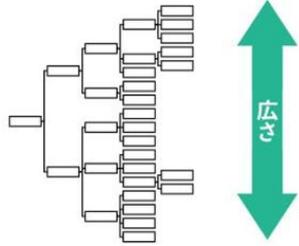
***発明の「構成(工程)」と「課題(≒効果)」をロジックツリーで解析し、当初明細書に記載する発明を最大化する。**

**⇒当初クレームは無関係。分割出願可能範囲を最大化する
+構造把握による中位概念の開示。(知財部、弁理士の付加価値)**

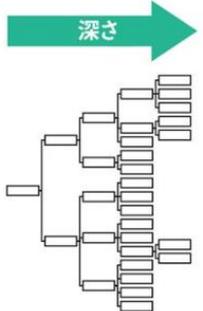
- ①深さ=Why so?の繰り返し、②広さ=前提を疑う、視座を変える、解決策の真の意味を再考、③構造=ストーリーを描く、解決範囲の再設定、新たな組み合わせ、要素間の相性を考える、

**分ける、
比べる、
関連付ける、
省く、
制約を意識、
質問する、
他との連携、**

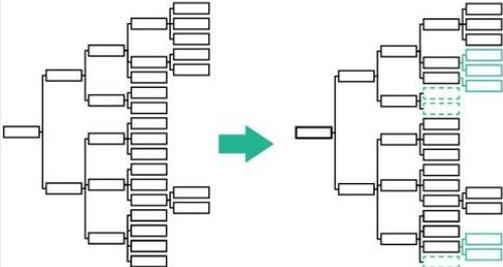
広さの視点
考慮する原因や要因、
アプローチの多様性を確保する。



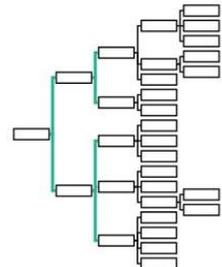
深さの視点
原因や要因、方法を
細かく具体的に掘り下げる。



時間の視点
経時変化や因果関係、
物事のプロセスや流れを捉える。

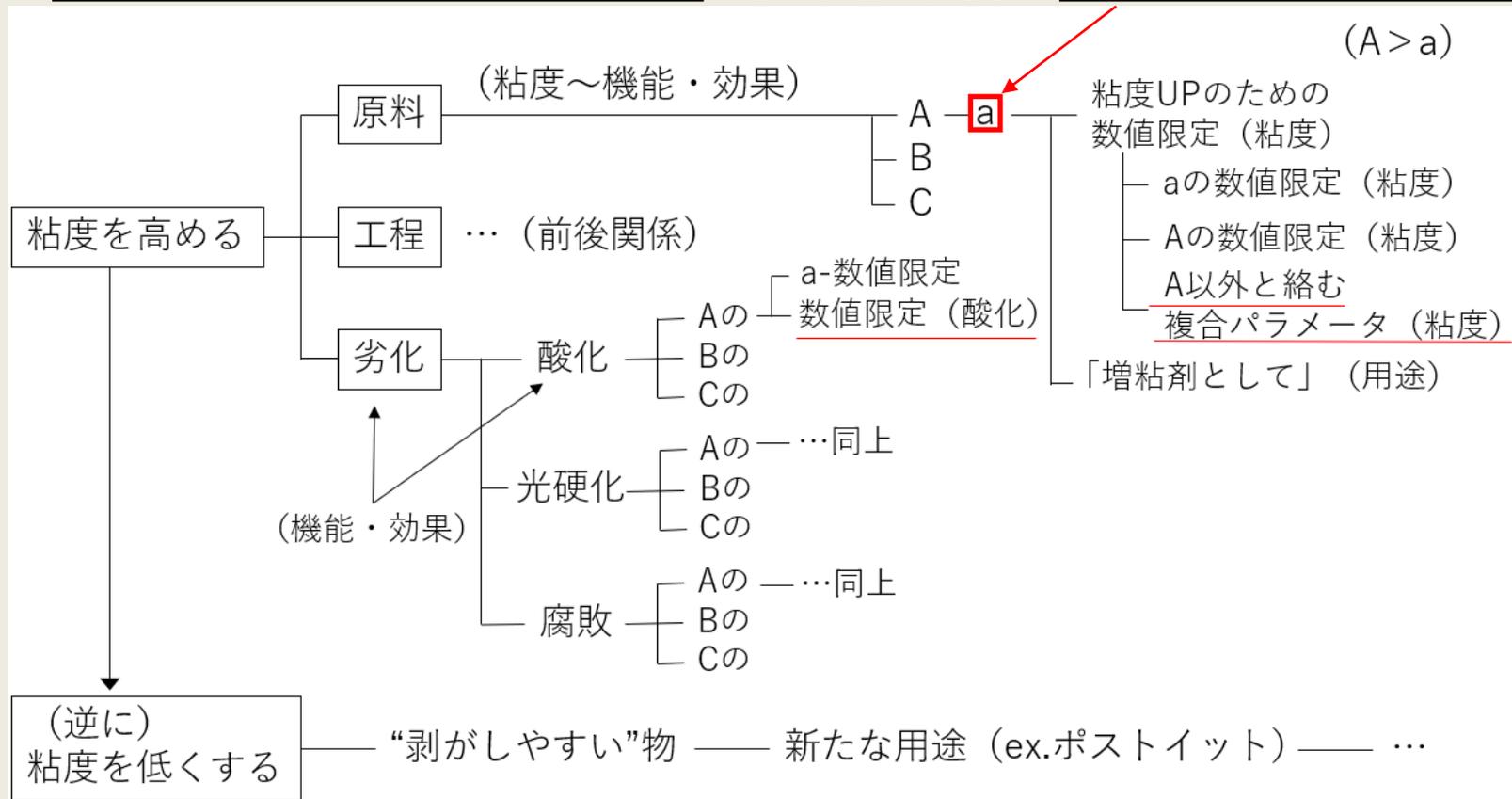


構造の視点
「深さ」や「広さ」の視点で見えてきた要素を、
意味のある形で分け、要素間の関係性や
それぞれの相対的な重要性を把握する。



出願時の必須検討事項～①深さ、②広さ、③構造、④時間

課題～粘度を高めて剥がれ難くする。／**発明提案書**～物質aを入れると粘度UP。



※(進歩性でなく、)サポート要件、実施可能要件のために、必要に応じてB・C…もクレームアップする。

特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」

中位概念化(実施例を拡張できる限界)～実験等で確認した具体例が3-3である場合

新規事項追加でなければ、出願後でも、
図1よりも狭く、図2よりも広く権利化可能。
⇒特許出願戦略における最重要ポイント!!

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図1>

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図2>

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図3>

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図4>

弁理士/知財部が提供できる付加価値は、
発明者から具体例として3-3を聞いたとき、
縦横無尽に中位概念化を可能とすること!!

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図5>

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図6>

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図7>

・実施例が無い発明の権利化(図8)

・従来技術を除くクレーム(図9)

・機能的クレーム/効果のクレームアップ
/程度を表すクレーム(図10)

・数値限定/パラメータ発明(図11)

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図8>

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図9>

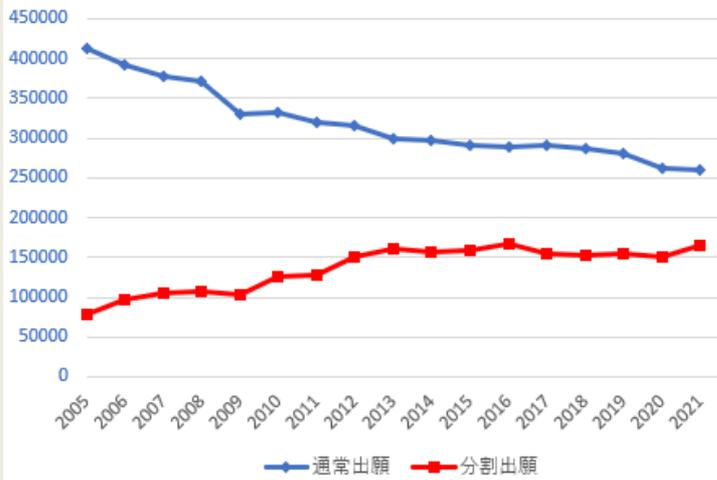
1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図10>

1-1	2-1	3-1	4-1	5-1
1-2	2-2	3-2	4-2	5-2
1-3	2-3	3-3	4-3	5-3
1-4	2-4	3-4	4-4	5-4
1-5	2-5	3-5	4-5	5-5

<図11>

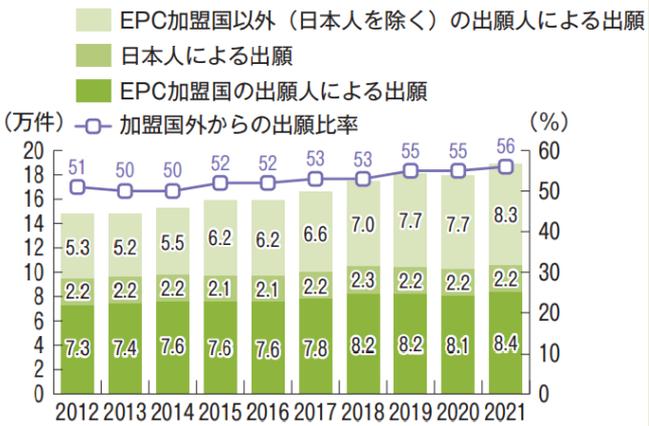
7. 特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地(『オプション権』)を確保する出願戦略(★) ~<統計>分割出願、日本企業の米欧中韓出願



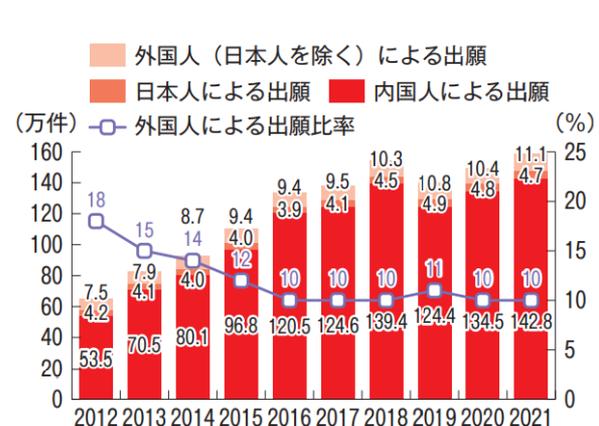
Patent Applications (出願総数) は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

表1 APPLICATIONS (米国出願数)	Patent Applications, U.S. Origin 米国起源	Patent Applications, Foreign Origin 外国起源 (日本起源)	Patent Applications, All Origin Total 出願総数 (Utility 特許数)	Patent Applications, Foreign Origin Percent Share 外国起源	Design Patent Applications 意匠
2021年	N/A	N/A	650,654 (593,294)	N/A	54,201
2020年	302,251	355,031 (104,971)	653,311 (603,764)	54.3%	46,105
2019年	316,076	350,759 (89,858)	666,843 (619,017)	52.5%	45,571
2018年	310,416	335,118 (87,872)	647,572 (599,174)	52.0%	46,360
2017年	316,718	332,522 (89,364)	650,350 (604,298)	51.1%	43,932

1-1-19図 【EPOにおける特許出願構造】



1-1-20図 【CNIPAにおける特許出願構造】



1-1-21図 【KIPOにおける特許出願構造】

